

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成19年5月10日(2007.5.10)

【公開番号】特開2004-339605(P2004-339605A)

【公開日】平成16年12月2日(2004.12.2)

【年通号数】公開・登録公報2004-047

【出願番号】特願2004-94941(P2004-94941)

【国際特許分類】

C 2 5 D	5/26	(2006.01)
C 2 5 D	5/02	(2006.01)
C 2 5 D	5/34	(2006.01)
C 2 5 D	7/00	(2006.01)
H 0 1 L	23/50	(2006.01)

【F I】

C 2 5 D	5/26	K
C 2 5 D	5/02	B
C 2 5 D	5/34	
C 2 5 D	7/00	G
H 0 1 L	23/50	A
H 0 1 L	23/50	D

【手続補正書】

【提出日】平成19年3月15日(2007.3.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項10】

- a) 金属合金基体を提供し；
- b) 該金属合金基体をフォトレジストでコーティングし；
- c) 化学線でフォトレジストを選択的に露光してフォトレジスト上にパターンを形成し；
- d) 露光されたフォトレジストを現像して該金属合金基体のパターンを露出させ；
- e) 該露出した金属合金基体をエッティングし；
- f) 該金属合金基体から、残存するフォトレジストを剥離してパターン化された金属合金基体を形成し；
- g) 該パターン化された金属基体上にサテン又は艶消し銅コーティングを堆積し；さらに
- h) 該サテン又は艶消し銅コーティング上にスズ又はスズ合金コーティングを堆積して物品を形成すること、を含む物品の形成方法。